

【11】證書號數：M581288

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 07 月 21 日

【51】Int. Cl. : H01H13/83 (2006.01)

新型

全 6 頁

【54】名稱：應用於發光鍵盤之遮罩結構

【21】申請案號：108202016 【22】申請日：中華民國 108 (2019) 年 02 月 15 日

【72】新型創作人：吳梵偉 (TW) WU, FAN-WEI

【71】申請人：茂林光學股份有限公司 GLT OPTICAL INC.
苗栗縣銅鑼鄉銅科一路 6 號

【74】代理人：黃信嘉；謝煒勇

【57】申請專利範圍

1. 一種應用於發光鍵盤之遮罩結構，供以設置於發光鍵盤之一背光模組內，包含：
一擴散型反射片本體，為薄膜狀結構體且具有複數穿孔，該複數穿孔供複數鍵帽之鍵腳通過；及
一遮光層，其係塗覆於該擴散型反射片本體之上表面，且該遮光層與各該穿孔之邊緣夾設形成一留白區，其中，該留白區具有透光性質，以形成一均勻亮圈於該鍵帽之四周。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之應用於發光鍵盤之遮罩結構，其中，各該留白區為方框形，且各該留白區之邊框寬度係介於 0.85mm ~ 1.15mm。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之應用於發光鍵盤之遮罩結構，其中，各該留白區之邊框寬度較佳為 1mm。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之應用於發光鍵盤之遮罩結構，其中，該擴散型反射片本體為一白色反射片，且厚度為 0.02~0.05mm。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述之應用於發光鍵盤之遮罩結構，其中，該遮光層係為一黑色油墨塗層。

圖式簡單說明

第 1 圖，為本創作較佳實施方式之遮罩結構示意圖。

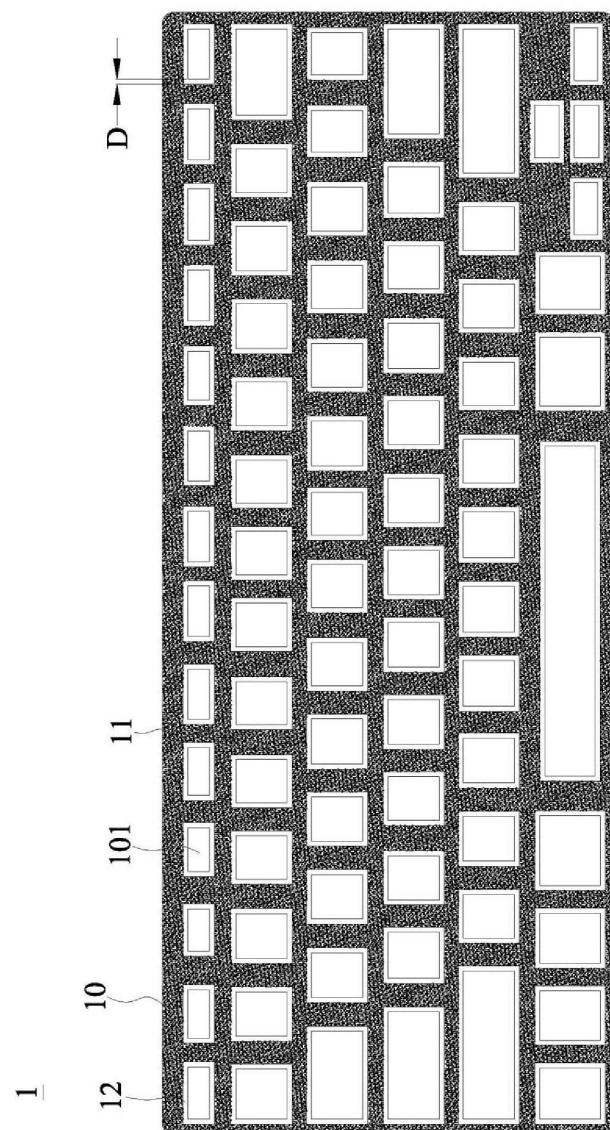
第 2 圖，為本創作較佳實施方式之遮罩結構剖面示意圖。

第 3 圖，為本創作較佳實施方式之遮罩結構與鍵帽應用示意圖。

第 4 圖，為本創作較佳實施方式遮罩結構搭配導光板與發光源之分解示意圖。

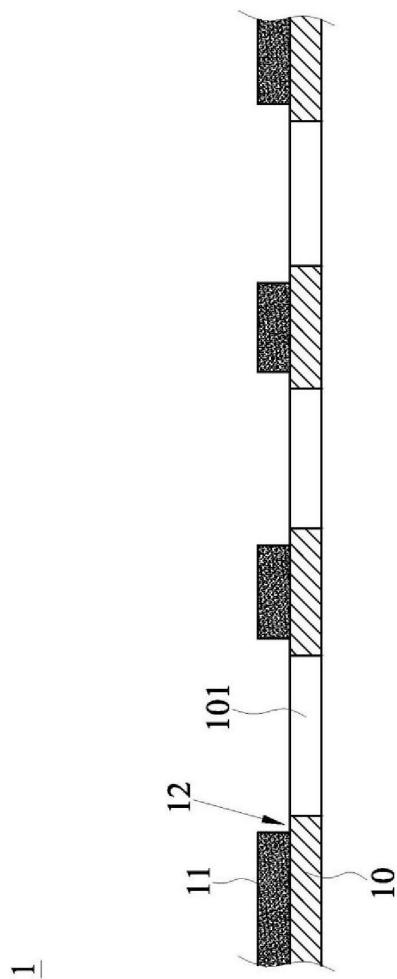
第 5 圖，為本創作較佳實施方式於鍵帽四周形成均勻亮圈之應用示意圖。

(2)



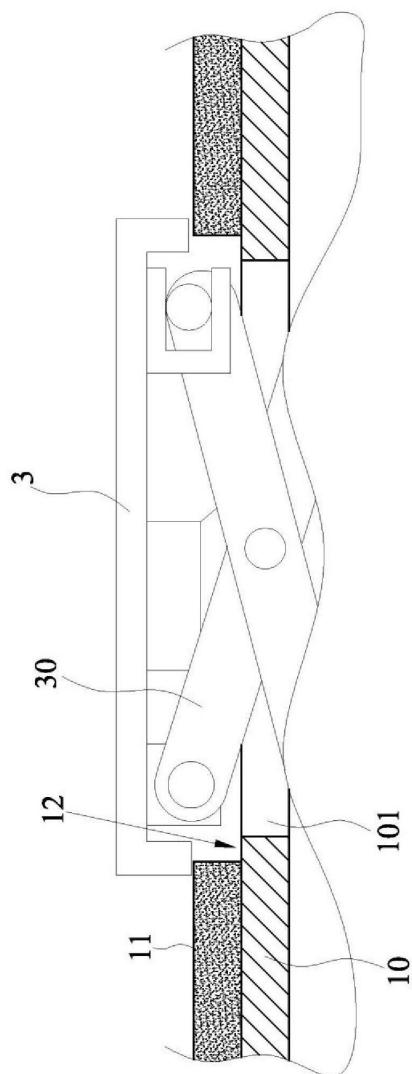
【第1圖】

(3)

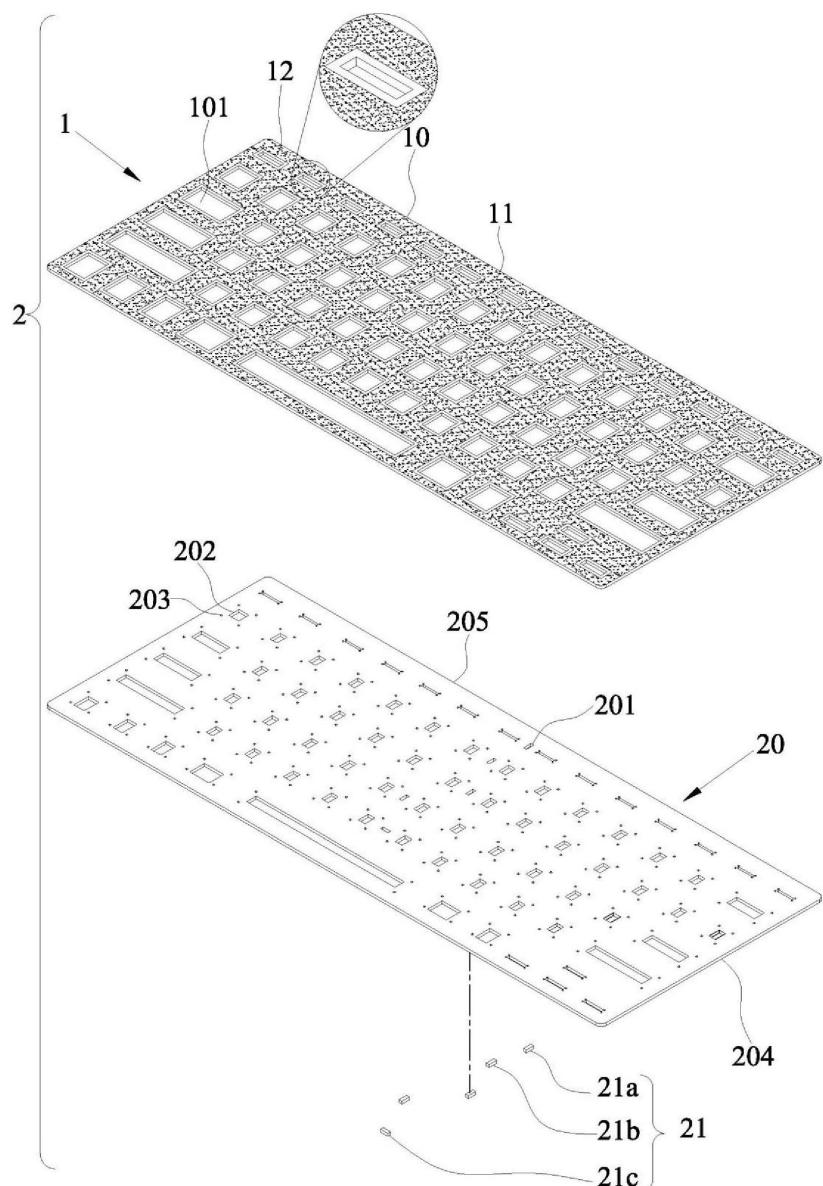


【第2圖】

(4)

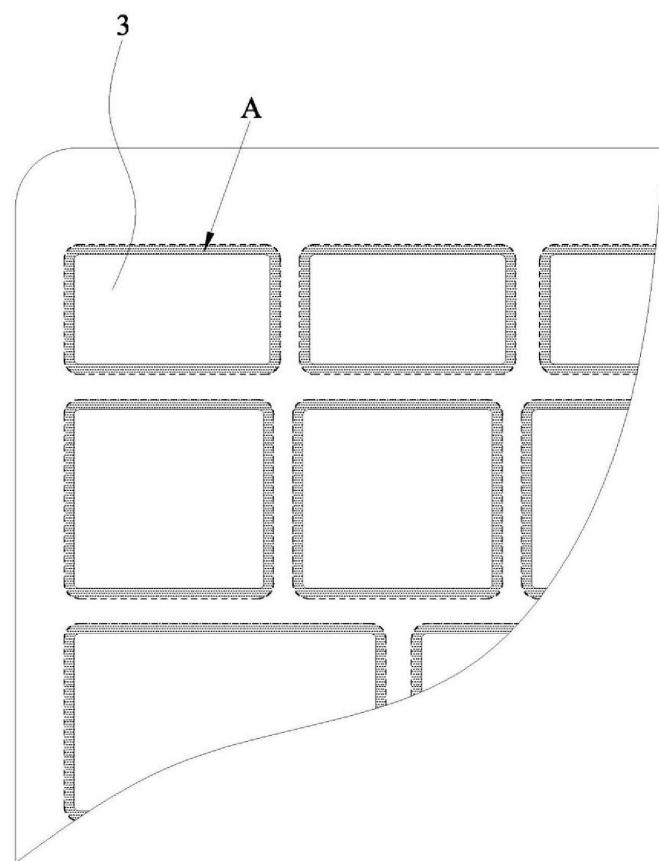


【第3圖】



【第4圖】

(6)



【第5圖】